

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成16年10月7日(2004.10.7)

【公開番号】特開2001-96900(P2001-96900A)

【公開日】平成13年4月10日(2001.4.10)

【出願番号】特願平11-275821

【国際特許分類第7版】

B 4 1 M 5/00

B 0 5 D 5/04

B 0 5 D 7/04

B 0 5 D 7/24

B 4 1 J 2/01

【F I】

B 4 1 M 5/00 B

B 0 5 D 5/04

B 0 5 D 7/04

B 0 5 D 7/24 3 0 2 B

B 4 1 J 3/04 1 0 1 Y

【手続補正書】

【提出日】平成15年9月22日(2003.9.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

透明支持体上に気相法シリカを含有するインク受容層を塗布し乾燥するインクジェット記録材料の製造方法において、塗布されたインク受容層を20℃以下の雰囲気下で冷却した後乾燥することを特徴とするインクジェット記録材料の製造方法。

【請求項2】

前記乾燥するときの空気の温度が60℃以下である請求項1に記載のインクジェット記録材料の製造方法。